

На рис. 2 показана эволюция частного цикла ПП со временем при фиксированной температуре  $T_1$  после отжига сегнетокерамики при температуре выше  $T_c$ . Хорошо видно, как с течением времени сигарообразная петля постепенно превращается в двойную ПП. Рис. 3 иллюстрирует тот факт, что при выдержке при постоянных температуре и поле  $E_{\perp} < E_c$  в течение 20 ч двойная петля становится асимметричной, а место перетяжки соответствует точно той величине поля  $E_{\perp}$ , при которой выдерживался образец.

Таким образом, нами обнаружен новый эффект памяти величины и знака поля  $E_{\perp}$ , длительно воздействовавшего на образец ЦСП в квазисегнетофазе. Объяснение данного эффекта удовлетворительно укладывается в рамках предположения о возможности возникновения в данной области модулированной фазы.

Авторы выражают благодарность М. Я. Дамбекалне за предоставленные образцы сегнетокерамики.

### Литература

- [1] Janet J. P., Lederer P. Ferroelectrics Lett., 1984, v. 1, N 5—6, p. 139—142.
- [2] Blox O. Г., Каминский Б. В., Китых А. В. и др. ФТТ, 1985, т. 27, № 11, с. 3436—3439.
- [3] Леманов В. В., Браженина Б., Есаян С. Х., Караваев А. ФТТ, 1984, т. 26, № 5, с. 1331—1333.
- [4] Carl K., Geissen K. Proc. IEEE, 1973, v. 61, N 7, p. 967—974.
- [5] Shilnikov A. V., Burkhanov A. I., Dontsova L. I., Nadolinskaja E. G. Ferroelectrics, 1986, v. 69, N 1—2, p. 111—115.
- [6] Шильников А. В. Автореф. канд. дис. Воронеж. 1972. 16 с.
- [7] Keve E. T., Annis A. D. Ferroelectrics, 1973, v. 5, N 1—2, p. 77—89.

Волгоградский  
инженерно-строительный институт

Поступило в Редакцию  
25 октября 1986 г.

УДК 537.521.7

Журнал технической физики, т. 58, в. 5, 1988

## ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ДИЭЛЕКТРИКА НА ФРОНТЕ ИМПУЛЬСА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЕГО АМПЛИТУДЫ

A. M. Бонч-Бруевич, B. N. Смирнов

Воздействие на среду импульсов лазерного излучения с пиковой плотностью мощности  $q_0$ , превышающей пороговую для развития оптического пробоя  $q^*$ , сопровождается образованием плазмы, практически полностью поглощающей лазерное излучение с момента ее инициирования [1]. Искажение формы импульса излучения, прошедшего через плазму, наблюдалось в ходе исследований пробоя в газах [2], в объеме и на поверхности прозрачных диэлектриков [3—7] и на поверхности металла [8]. При этом неоднократно отмечалось удобство использования этого явления для фиксирования момента инициирования плазмы. В [6, 9] описан метод измерения порога оптического пробоя, основанный на регистрации величины пиковой плотности мощности импульса излучения, прошедшего через плазму,  $q_{\text{п}}$ , при использовании импульсов воздействующего на образец излучения с  $q_0$ , в несколько раз превосходящей  $q^*$ . Этот метод действительно удобен в ситуациях, когда развитие пробоя определяется лишь величиной  $q$ , что характерно для собственного пробоя. Однако это условие должно нарушаться в случае пробоя, инициируемого нагревом поглощающих неоднородностей (ПН), или если для развития пробоя необходимо испарение с поверхности мишени поглощающего слоя [10].

В настоящей работе проведено сопоставление результатов измерений порогов оптического пробоя на поверхности и в объеме NaCl и KCl, выполненных в последнее время широко используемым методом [11]  $q_{\text{п}}^*$  и методом, описанным в [6, 9],  $q_{\text{п}}^*$ . Полученные экспериментальные данные показывают, что при  $q_0 > q_{\text{п}}^*$  и дальнейшем нарастании  $q_0$  наблюдается рост  $q_{\text{п}}^*$ . В связи с этим в условиях, когда пробой обусловлен нагревом ПН, метод измерения порога, основанный на регистрации  $q_{\text{п}}$ , представляется непригодным. В то же время экспериментальные данные хорошо согласуются с результатами анализа, выполненного на основе представлений, развитых в [12]. Показано, что следующий из проведенного анализа рост  $q_{\text{п}}$  может ослабляться влиянием на измеряемую величину порога его размерной зависимости, особенно сильно выраженной в области малых значений размеров облучаемого пятна.

В экспериментах использовался CO<sub>2</sub> лазер с поперечным разрядом, характеристики импульсов излучения которого описаны в [12]. Излучение лазера, ослабляющееся калиброванными фильтрами, фокусировалось на поверхность или в объем образца. В качестве образцов использовались полированные плоскопараллельные пластины и кристаллы размером 80×40×20 мм, выколотые из булы (для измерений в объеме). Уровни мощности излучения, падающего на образец и прошедшего через него, контролировались приемниками на увлечении с выходом на двухлучевой осциллограф. Для фокусировки излучения использовались линзы с различными фокусными расстояниями, позволявшие менять диаметр облучаемой области почти на порядок.

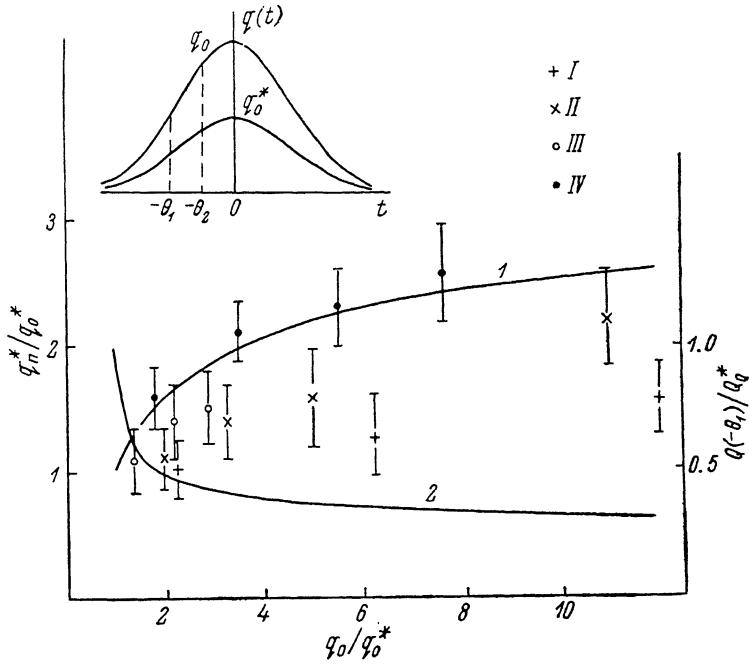


Рис. 1. Зависимости  $q_n^*/q_0^*$  (1, I—IV) и  $Q(-\theta_1)/Q_0^*$  (2) от  $q_0/q_0^*$  при оптическом пробое близи поверхности NaCl.

Кривые — расчет; точки — эксперимент при  $d = 0.14$  мм и  $q_0^* = 160 \pm 20$  МВт/см<sup>2</sup> (I),  $0.28 \mu 100 \pm 20$  (II),  $0.56$  и  $70 \pm 10$  (III),  $0.56$  (на поверхность образца нанесены частицы SiO<sub>2</sub>) и  $40 \pm 10$  (IV). Вверху — импульсы с амплитудами  $q_0^*$  и  $q_0 > q_0^*$ .

Пороги оптического пробоя измерялись двумя методами. Первый из них [11] предполагал проведение серии измерений (~30) с различной величиной  $q_0$  при облучении образца каждый раз в новом месте. За порог принималась величина

$$q_0^* = \frac{1}{2} [q_{\max}(-) + q_{\min}(+)] \pm \frac{1}{2} |q_{\max}(-) - q_{\min}(+)|,$$

где  $q_{\max}(-)$  — максимальное значение  $q_0$ , при котором плазма (разрушение) не наблюдалась;  $q_{\min}(+)$  — минимальное значение  $q_0$ , при котором плазма (разрушение) появлялась. При использовании второго метода [6, 9] калиброванным приемником регистрировалась пикивая мощность излучения, прошедшего образец и плазму пробоя, а за порог  $q_0^*$  принималось среднее из пяти значений  $q_n$  при одном и том же уровне  $q_0$ , вызывавшем образование плазмы.

Результаты измерений порогов пробоя на поверхности NaCl приведены на рис. 1, где показаны зависимости  $q_n^*/q_0^*$  от  $q_0/q_0^*$  для трех значений диаметра облучаемой области  $d$  (0.14, 0.28, 0.56 мм). Видно, что для всех  $d$  с ростом  $q_0/q_0^*$  экспериментальные точки все дальше отклоняются от уровня  $q_n^*/q_0^* = 1$ , которому они все должны соответствовать согласно [6, 9], причем тем значительнее, чем больше  $d$ .

Полученные результаты могут быть объяснены на основе сказанного в [12] об условиях развития оптического пробоя у поверхности твердого тела. В соответствии с [12]: 1) плотность энергии, поглощенной опасными ПН к моменту инициирования пробоя, должна превышать уровень  $Q_0^*$ , достаточный для появления у поверхности тела необходимой концентрации паров или затравочных электронов; 2) плотность мощности излучения должна превышать уровень  $q_{\text{пп}}^*$ , при котором наличие у поверхности паров или электронов приводит к развитию пробоя.

Рассмотрим воздействие на поверхность тела импульса излучения (рис. 1) гауссовой 1 формы

$$q(t) = q_0 \exp(-t^2/2\tau^2).$$

Тогда плотность энергии в момент времени  $t = -\theta$  равна

$$Q(-\theta) = \int_{-\infty}^{-\theta} q(t) dt = \sqrt{\pi/2} q_0 \tau [1 - \Phi(\theta/\tau)].$$

В соответствии со сказанным выше при пробое под действием импульса с  $q_0 = q_0^* > q_{\text{пр}}^*$  для  $Q$  в момент времени  $t = 0$  можно написать

$$Q(0) = \sqrt{\pi/2} q_0^* \tau \geq Q^*.$$

Наблюдавшееся снижение  $q_0^*$  при нанесении на поверхность образца сильноглощающих частиц [13], по-видимому, означает, что в условиях проводимых экспериментов второе условие выполняется раньше первого и пробой развивается, когда  $Q(0) = Q_0^*$ . В случае импульсов с  $q_0 > q_0^*$  введем в рассмотрение два момента времени  $t = -\theta_1$  и  $t = -\theta_2$ . Значение  $\theta_1$  определим из условия  $q(-\theta_1) = q_0^*$ , а  $\theta_2$  из условия  $Q(-\theta_2) = Q_0^* = \sqrt{\pi/2} q_0^* \tau$ . Далее, определив  $Q(-\theta_1)$  и сравнив  $Q(-\theta_1)$  в импульсе с  $q_0 > q_0^*$  и  $Q(0) = Q_0^*$  в импульсе с  $q_0 = q_0^*$ , найдем зависимость (рис. 1)

$$Q(-\theta)/Q_0^* = (q_0/q_0^*) \{1 - \Phi[\sqrt{2 \ln(q_0/q_0^*)}]\}.$$

Ход ее означает, что к моменту выполнения второго условия первое при  $q > q_0^*$  остается еще не выполненным, причем тем более явно, чем больше  $q_0/q_0^*$ .

Величина  $\theta_2$  может быть найдена из уравнения

$$q_0 [1 - \Phi(\theta_2/\tau)] = q_0^*.$$

Поскольку при  $q_0 > q_0^*$  в момент времени  $t = -\theta_2$  оба условия развития пробоя оказываются выполненными, то естественно считать  $q(-\theta_2)$  пороговой плотностью мощности, т. е.  $q(-\theta_2) = q_{\text{п}}^*$ . В связи с этим в момент времени  $-\theta_2$  должна инициироваться плазма, обрезающая хвост импульса. Зависимость  $q_{\text{п}}^*/q_0^*$  от  $q_0/q_0^*$  приведена на рис. 1. Сопоставление экспериментальных данных с расчетными указывает на их удовлетворительное согласие лишь при  $d = 0.56$  мм. Этот результат может быть связан с влиянием на результаты измерений размерной зависимости порога пробоя. Действительно, проведение измерений при больших  $q_0$  сопряжено с увеличением размеров области, в пределах которой выполняются пороговые условия для опасных ПН, и с ростом вероятности попадания в нее ПН.

Для проверки этого предположения были проведены измерения  $q_{\text{п}}^*$  и  $q_{\text{п}}$  после нанесения на поверхность образца сильноглощающих частиц  $\text{SiO}_2$  размерами  $\sim 3$  мкм, что привело к существенному снижению  $q_0^*$  и  $q_{\text{п}}^*$ . Полученные в этих измерениях экспериментальные данные хорошо согласуются с расчетной зависимостью  $q_{\text{п}}^*/q_0^*$ . Таким образом, использование второго метода [6, 8] и других методов [7] измерения порога пробоя, основанных на измерениях при  $q_0 > q_0^*$ , должно давать значения порогов, заметно превосходящие  $q_0^*$ . Исключения могут быть связаны с влиянием размерной зависимости порога пробоя.

Развитые представления, по-видимому, должны быть справедливы и при пробое в объеме прозрачного диэлектрика, инициируемом ПН. Для проверки сказанного были проведены исследования пробоя в  $\text{NaCl}$  и  $\text{KCl}$  при  $d = 0.07, 0.14$  и  $0.28$  мм. В отличие от наблюдавшегося на поверхности (где инициирование плазмы приводило к существенному искажению формы импульса прошедшего через нее излучения) появление вспышки плазмы в объеме и образование видимых невооруженным глазом трещин не сопровождалось резкой отсечкой хвоста импульса. С ростом  $q_0$  величина искажений импульса нарастала медленно (особенно при  $d = 0.28$  мм). В связи с этим не ясно, какие параметры плазмы или размеры разрушения следует считать соответствующими  $q_0^*$ . Поэтому  $q_0^*$  не определялась. Вместо этого исследовалась зависимость  $q_{\text{п}}(q_0)$ . Длины треков и размеры очагов разрушения, образующихся в пределах каустики линзы, зависели от концентрации и сечения поглощения ПН,  $d$  и мощности излучения. В одном из образцов  $\text{KCl}$  при  $d = 0.28$  мм и  $q \sim 1500$  МВт/см $^2$  длина треков достигала 6 см, а размеры крупных очагов в средней области трека 3—5 мм. В образцах  $\text{NaCl}$  с более

<sup>1</sup> Важно, что в большинстве случаев по крайней мере передний фронт импульса может быть описан указанной функцией.

низкими концентрациями ПН при  $d=0.07$  мм и  $q \geq 20\,000$  МВт/см<sup>2</sup> размер крупных очагов растрескивания составлял 5–6 мм, а длина трека не превышала 10<sup>3</sup> мм. Зависимости  $q_{\text{п}}(q_0)$  для одного из образцов KCl при  $d=0.07$ , 0.14 и 0.28 мм показаны на рис. 2. Видно, что линейные участки  $q_{\text{п}}(q_0)$  сменяются сублинейными. При этом образование отдельных микроразрушений и даже их цепочек не приводило к отклонениям зависимостей  $q_{\text{п}}(q_0)$  от линейных.

Как следует из рис. 2, при  $d=0.28$  мм  $q_{\text{п}}(q_0)$  линейна вплоть до 160 МВт/см<sup>2</sup>, порог же образования микроразрушений для этого образца близок к 20 МВт/см<sup>2</sup>.

Несмотря на разброс точек, соответствующих экспериментальным данным, очевидны отсутствие насыщения зависимостей  $q_{\text{п}}(q_0)$  и качественное сходство полученных результатов для объема и для поверхности.

Вместе с тем следует отметить более слабое поглощение излучения при пробое в объеме образца по сравнению с наблюдавшимся в плазме поверхностного пробоя. Оказалось, что воздействие импульса излучения с  $q_0=q_{02}$  на область кристалла в объеме, разрушенную воз-

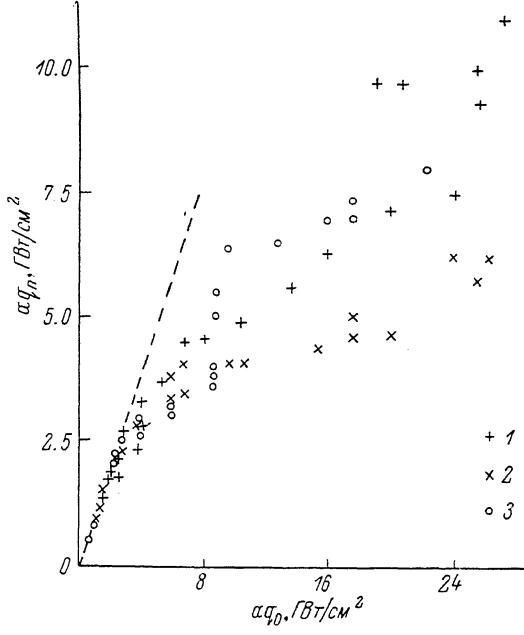


Рис. 2. Зависимости  $q_{\text{п}}(q_0)$  при оптическом пробое в объеме KCl.

1 —  $d=0.07$  мм,  $a=1$ ; 2 — 0.14, 4; 3 — 0.24, 16.

действием импульса с  $q=q_{01} > q_{02}$ , сопровождается более существенным снижением  $q_{\text{п}}$ , чем в случае воздействия импульса с  $q_0=q_{02}$  на неразрушенную область. Это, по-видимому, означает, что врезание импульса, прошедшего через разрушающую область в объеме образца, существенный вклад вносит рассеяние на трещинах.

Таким образом, в настоящей работе получены результаты, подтверждающие, что для развития оптического пробоя, инициируемого нагревом поглощающих неоднородностей, необходимо выполнение двух условий, упомянутых в [12]. Показано, что использование способа измерения порога пробоя, основанного на регистрации  $q_{\text{п}}$ , приводит к завышенным результатам, причем ошибка тем существеннее, чем больше величина  $q_0/q_0^*$ . Сказанное не затрагивает случая собственного пробоя в объеме прозрачного диэлектрика, где величина порога  $q_0^*$  не должна зависеть от  $q_0$  (при  $q_0 > q_0^*$ ), что и наблюдалось экспериментально в [14].

#### Литература

- [1] Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения. М.: Мир, 1974. 408 с.
- [2] Meyerand R. G., Haught A. F. Phys. Rev. Lett., 1964, v. 13, N 1, p. 7–9.
- [3] Ашканиадзе Б. И., Владимиров В. Т., Лигачев В. А. и др. ЖЭТФ, 1966, т. 50, № 5, с. 1187–1201.
- [4] Fradin D. W., Yablonovitch E., Bass M. Appl. Opt., 1973, v. 12, N 4, p. 700–709.
- [5] Бломберген Н. Квант. электр., 1974, т. 1, № 4, с. 786–805.
- [6] Ковалев В. И., Морозов В. В., Файзуллов Ф. С. Квант. электр., 1974, т. 1, № 10, с. 2172–2177.
- [7] Догадов В., Смирнов В. Н. ЖТФ, 1976, т. 46, № 10, с. 2225–2227.
- [8] Walters C. T., Barnes R. N., Beverly R. E. III. J. Appl. Phys., 1978, v. 49, N 5, p. 2937–2949.
- [9] Ковалев В. И. Тр. ФИАН, 1982, т. 136, с. 51–117.
- [10] Барзуков А. И., Бункин Ф. В., Конов В. И., Любин А. А. ЖЭТФ, 1974, т. 66, № 3, с. 965–982.
- [11] Stewart A. F., Guenter A. H. Appl. Opt., 1984, v. 23, N 21, p. 3774–3778.
- [12] Бонч-Бруевич А. М., Смирнов В. Н. ЖТФ, 1984, т. 54, № 11, с. 2184–2189.
- [13] Смирнов В. Н. Оптическая промышленность, 1986, № 7, с. 1–4.
- [14] Глебов Л. Б., Ефимов О. М., Либенсон М. Н., Петровский Г. Т. ДАН СССР, 1986, т. 287, № 5, с. 1114–1118.

Поступило в Редакцию  
30 января 1987 г.